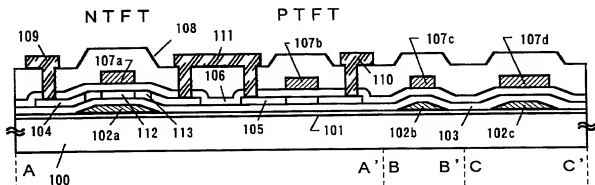
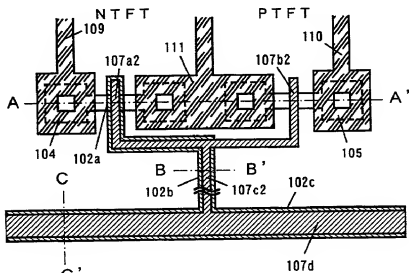


【書類名】 図面

【図1】



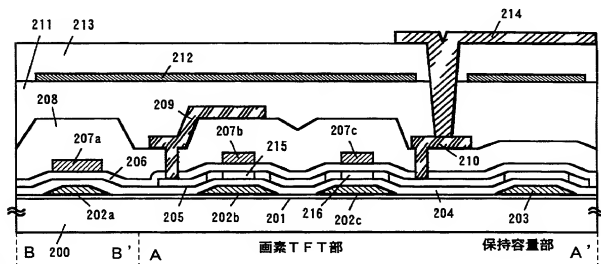
(A)



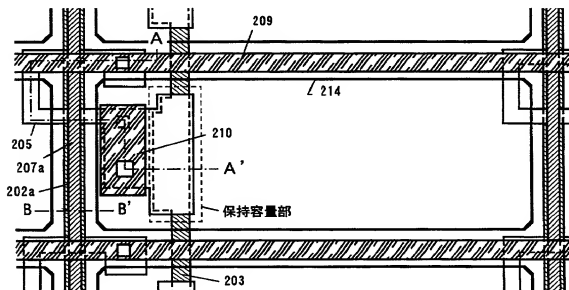
(B)

100:基板 101:下地膜 (TaOx) 102a, 102b, 102c: 第1配線
 103: 第1絶縁層 104, 105: 活性層 106: 第2絶縁層
 107a, 107b, 107c, 107d: 第2配線 108: 第1層間絶縁層
 109, 110: ゲート配線 111: ドレイン配線

【図2】



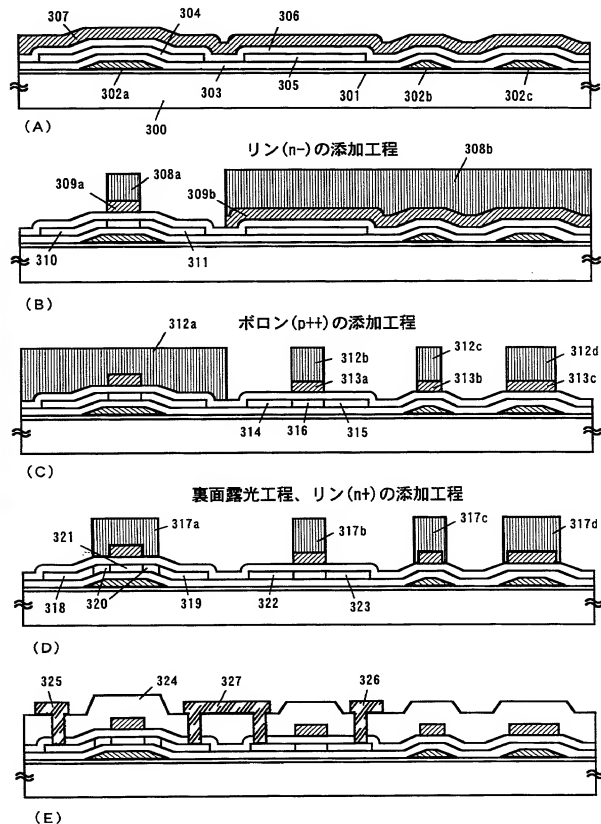
(A)



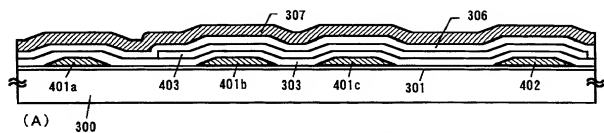
(B)

200:基板 201:下地膜(TaOx) 202a, 202b, 202c:第1配線 203:容量配線
204:第1絶縁層 205:活性層 206:第2絶縁層 207a, 207b, 207c:第2配線
208:第1層間絶縁層 209:ソース配線 210:ドレイン配線 211:第2層間絶縁層
212:ブラックス 213:第3層間絶縁層 214:画素電極 215, 216:パシブ形成領域

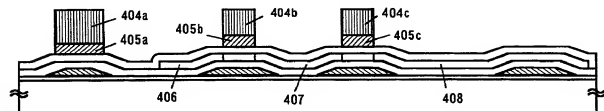
【図3】



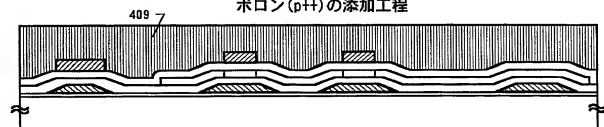
【図4】



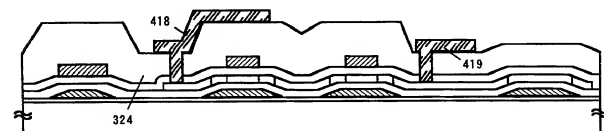
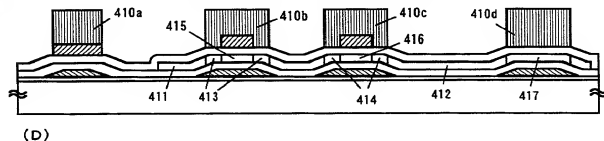
リン(n-)の添加工程



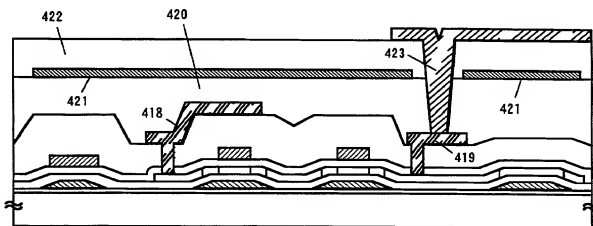
ボロン(p++)の添加工程



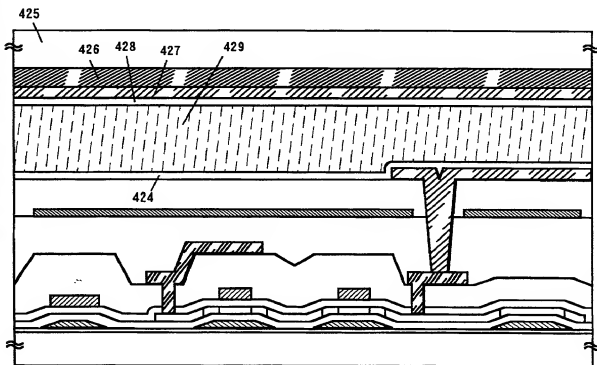
裏面露光工程、リン(n+)の添加工程



【図5】

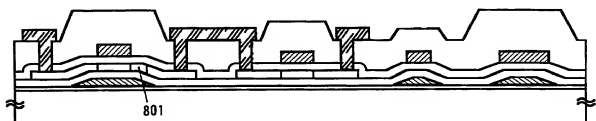


(A)

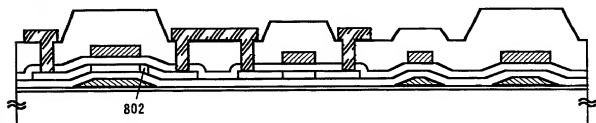


(B)

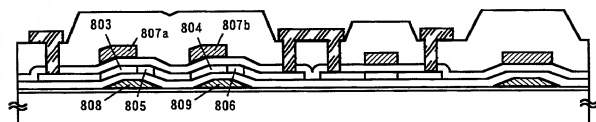
【図8】



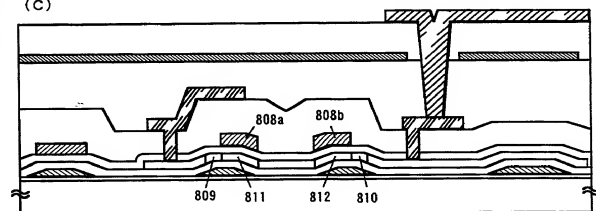
(A)



(B)

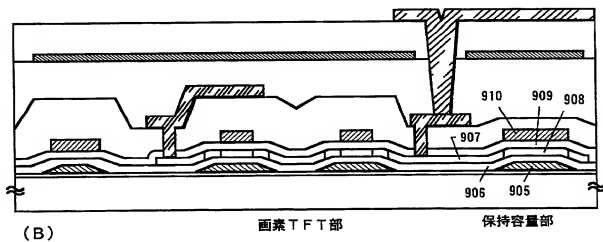
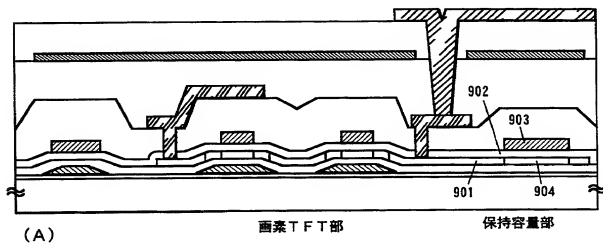


(C)

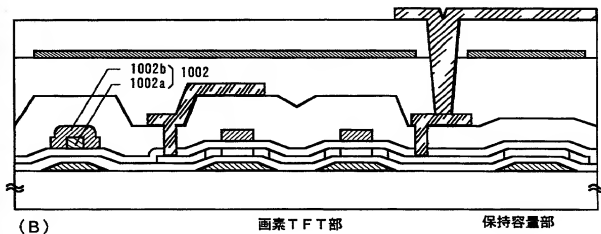
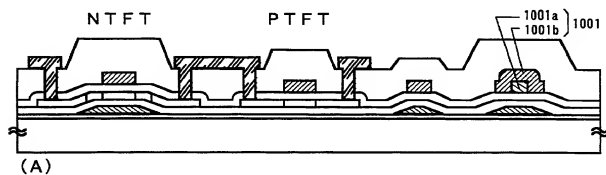


(D)

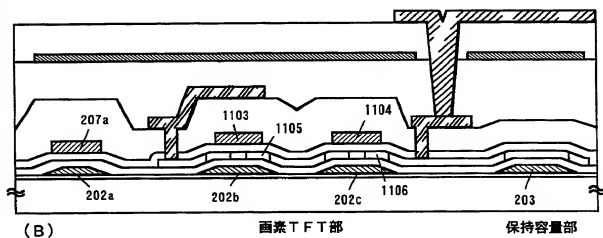
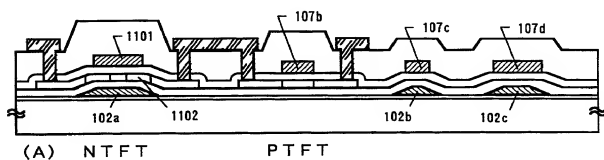
【図9】



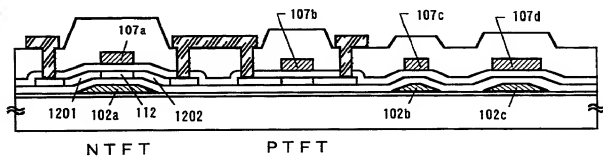
【図10】



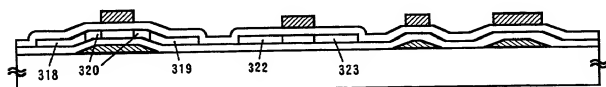
【図11】



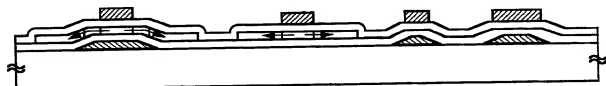
【図12】



【図13】

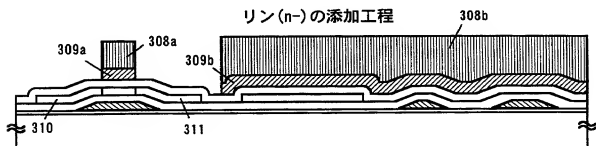


(A)

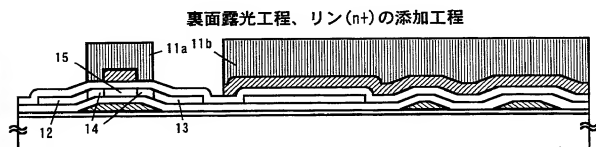


(B)

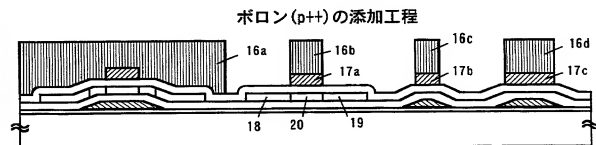
【図14】



(A)



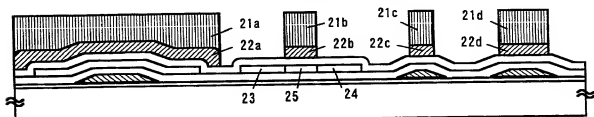
(B)



(C)

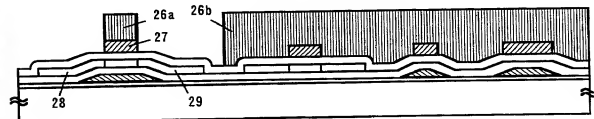
【図15】

ボロン(p++)の添加工程



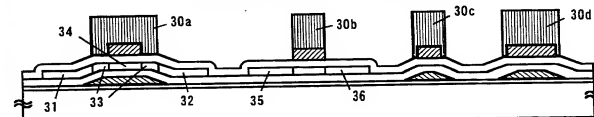
(A)

リン(n-)の添加工程



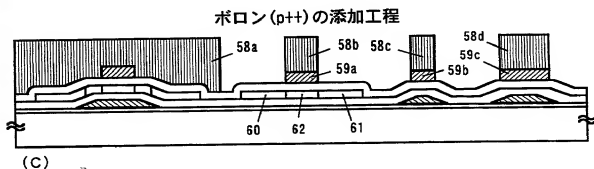
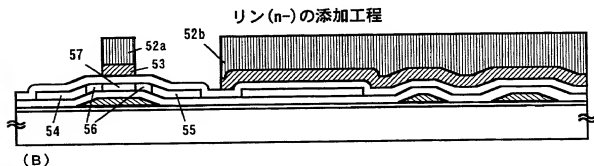
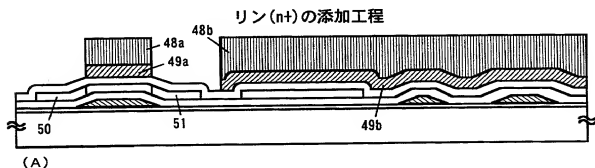
(B)

裏面露光工程、リン(n+)の添加工程



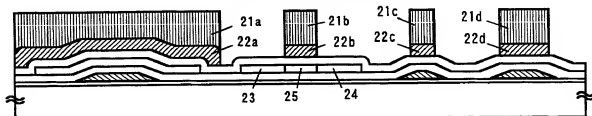
(C)

【図17】



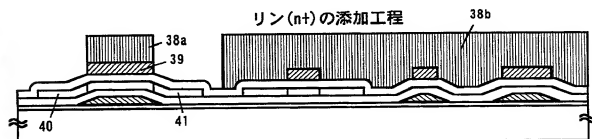
【図16】

ボロン(p++)の添加工程



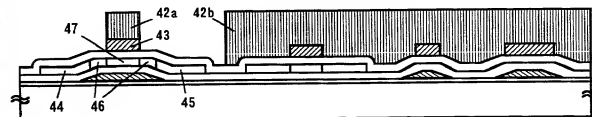
(A)

リン(n+)の添加工程



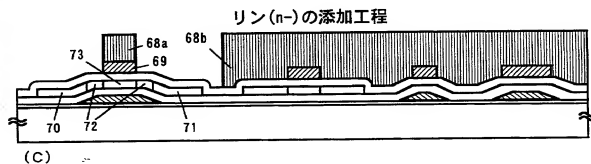
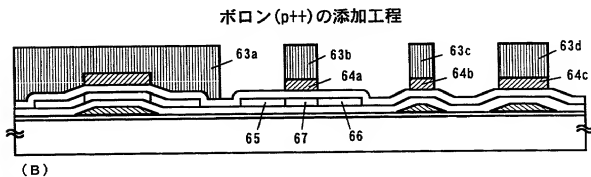
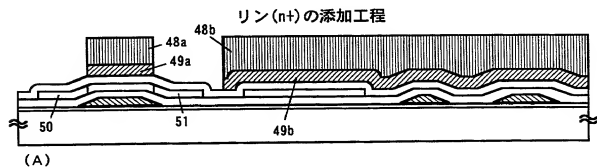
(B)

リン(n-)の添加工程

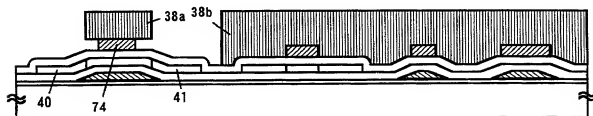


(C)

【図18】



【図19】



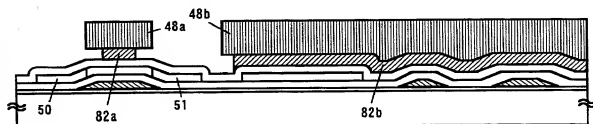
(A)

リン(n-)の添加工程



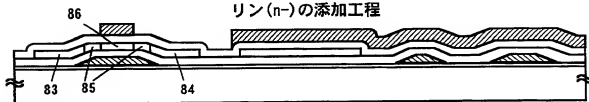
(B)

【図20】



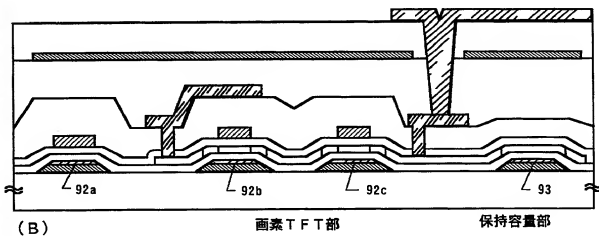
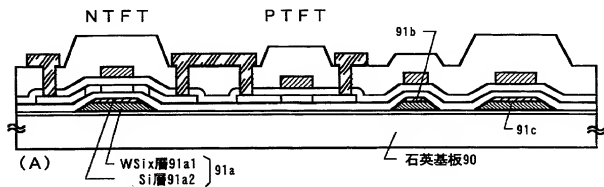
(A)

リン(n-)の添加工程



(B)

【図21】



【図22】

